# ランタン(La)ドープシリカ(SiO2)多孔質複合体の合成と構造解析

## Synthetic Study and Structural analysis of La-doped Microporous Silica composites

小林 正典\*, 小出 剛之\*\*

Masanori Kobayashi, Takeyuki Koide

## Summary

Silica containing Lanthanum (La) for the  $CO_2$  adsorption has been synthesized by a precursor solution method, involving heat treatment and reduction stages, and the dependence on La dose in the transformation of the crystal structure has been investigated systematically by X-ray diffraction (XRD).

As a result, XRD pattern of many kinds of Silica specimens showed the broad pattern, which means amorphous structure, while only the high La contain silica specimen (Si : La = 2 : 1) demonstrated many peaks of La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. This finding suggested that little La atoms might replace into the site of Si with the Si–O network as a mechanism of the transformation of the crystallization during heat treatment, have little effect to determine the crystallization of silica. To make a characteristic micro-porous structure for the CO<sub>2</sub> adsorption, the consisting of highly dispersed metallic La within a Si–O matrix should be necessary.

キーワード:シリカ、ランタン、エックス線回折、多孔質、結晶構造

Keywords : Silica(SiO<sub>2</sub>), Lanthanum (La), X-ray Diffraction (XRD), Micro-porous, Crystal structure

## 1. 序論

近年,地球温暖化の原因である温室効果ガスのなか で大きな割合を占める二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)の放出抑制 が求められており,窒素酸化物(NO<sub>x</sub>)や硫黄酸化物 (SO<sub>x</sub>)等を除去する排ガス処理の後に,効率的にCO<sub>2</sub> を回収できる装置の開発・実証試験などが進められて いる<sup>1)</sup>. CO<sub>2</sub>吸着基材としてはゼオライト,活性炭, アモルファスシリカなどが研究されているが,細孔径 制御,ガス親和性の検討などが課題となっている.ア モルファスシリカは Si-O-Si-6 員環構造をもち,これが ネットワークを形成している.合成手法や添加物によ りシリカの細孔径を制御でき,さらにガス種による吸 着分離が期待される.シリカにニッケル(Ni),コバル ト(Co),鉄(Fe)などの遷移金属を添加した場合, シリカ中に金属ナノ分散した金属ドープシリカが形成 でき、このシリカナノ粒子界面が選択的に水素親和性 を有し、水素吸着脱離サイトとして機能することが報 告されている<sup>2)</sup>.本研究では、CO2吸着基材として、 化学溶液法によるランタン(La)をドープしたシリカ多 孔質複合体を作製する過程<sup>3,4)</sup>で、La量によるシリカ の結晶化構造に対する影響をついて微細構造解析を行 い調べたので、ここに報告することとした.

#### 2. 実験方法

## 2.1 方法

ランタンドープシリカ多孔質複合体の調製は下記の 通りに行った.

はじめに、シリンジとマイクロピペットで無水エタ

<sup>\*</sup> 工学部総合機械工学科

<sup>\*\*</sup> 工学研究科機械工学専攻

ノールとテトラエトキシシランを計量し,ビーカー内 でスターラーにて混合した.その間エタノールの蒸発 を防ぐため,ビーカーを氷冷し,0℃に保持した.

次に薬包紙に La(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・6H<sub>2</sub>O をテトラエトキシシラ ン中に含まれる Si とのモル比がそれぞれ Si:La=1:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 4:1, 8:1になるように採取し, テフロンビーカー内に加え撹拌・溶解を行った.加え た添加物の溶解を確認したのち,マイクロピペットで 過酸化水素水を添加し,反応させるために2時間攪拌 した.その後,試料を 60℃温度一定の乾燥機で約一週 間乾燥させ,乾燥後の試料は乳鉢で粉砕し,大気中の 水分との反応を防ぐためにデシケーター内で保管した.

試料の焼成温度を決めるために示唆熱-熱重量同時 測定装置(TG-DTA)を用いて熱量・重量変化を解析 し、焼成温度を 600℃と決定した.乾燥試料を石英セ ルに乗せ、チューブ炉にセットし、焼成条件(昇温条 件は、2℃/分で昇温し、600℃で3時間焼成した後、5℃ /分で常温まで降温)に従って各試料を作製した.なお、 当初計画していた成分比 Si:La=1:1の試料は合成で きなかった.

## 2.2 解析

上記方法で得られた焼結試料は、エックス線回折(X ray Diffraction; XRD)によって、その結晶構造の解析 を、透過電子顕微鏡(TEM)および走査電子顕微鏡 (SEM)によって微細構造の観察を行った。

XRD 試験装置には, リガク RINT2500 ((株) リガ ク,日本)を用い,試験条件は,CuKα線,出力3kW, 50mA 20 角走査範囲 20~60°とした.

電子顕微鏡観察では, TEM に日本電子製 JEM-4000FX を, SEM に S-4500(日立製作所製)を用 いた.

#### 3. 結果

## 3.1 La ドープシリカの XRD 回折パターン

各種 La 量のシリカ試料についての XRD 回折パター ンの生データと解析結果を下記に示す.

Si:La=2:1 の試料の回折パターン例を図 3-1 に示す. この高 La 濃度のシリカでは,酸化ランタン(La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)の 回折ピークが 8 つ観察された.

回折線のピークの同定から、それぞれ図のような結 晶面が確認された.



Fig.3-1 XRD pattern for the La-dope Silica specimen (Si: La = 2:1)

Si: La = 2.5: 1の回折パターン(図.3-2)では,酸化ラ ンタン(La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)の回折ピークは1つのみ観察された.



Fig.3-2 XRD pattern for the La-dope Silica specimen (Si: La = 2.5 : 1)

Si:La=3:1の回折パターン例を図 3-3 に示す. この試料の場合も, Si:La=2.5:1の時と同様に,酸化ランタン (La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)の回折ピークが1つのみ観察された. いずれも 結晶面は(011)であった.



Fig.3-3 XRD pattern for the La-dope Silica specimen

#### (Si:La=3:1)

成分比 Si:La=4:1 の試料では,酸化ランタン(La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) の回折ピークが (002),(011)の 2 つ観察された(図 3-4).





Si:La=8:1 の回折パターン(Fig.3-5)では、ブロードに なり回折ピークを確認することが出来なかった.



Fig.3-5 XRD pattern for the La-dope Silica specimen (Si: La = 8:1)

#### 3.2 微細構造の観察

作製した試料の SEM と TEM による観察像を図 2 に示す.

図 2-1 に成分比 Si:La=4:1 の試料の SEM 画像を示す. 表面形状からは,高倍率でも特にシリカの多孔質構 造は確認できなかった.

一部に見られる白いコントラスト部分がシリカ表面 に分布した酸化ランタン La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> と推察された.

この試料を粉砕し, TEM にて観察を行ったところ, 格子像が確認でき,同時に解析して得られた電子線回 折パターンは La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の(100)面,(012)面間隔に一致した (図 2-2).



Fig.2-1 SEM image of La-dope Silica specimen (Si: La = 2: 1)



Fig.2-2 TEM image and the electron diffraction pattern of La-dope Silica specimen (Si : La = 2: 1)

## 4. 考察

シリカはアモルファス構造をもつ代表的な材料である. 今回の実験でも, Si: La = 2:1以外の多くの試料では,回折ピークが少なくブロードで,アモルファス構造を呈していることが確認された.

図3にランタンのドープ量とシリコン材料で同定された酸化ランタン La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の結晶面の数との関係を示す. ランタンの添加量を大きくしていくにつれて,より多 くの結晶面を持つシリカが合成された.



Fig.3 The correlation of the number of crystal faces and the amount of La in La-dope Silica specimen

特に,今回の結果では,La/La/Si = 33%(成分比 Si:La = 2:1)まで,ほぼアモルファス状態が維持され,33% La で急激な結晶面の増加が見られた.元来非晶質構造 であるシリカ<sup>5)</sup>にLa の添加量を大きくしていくと,あ る一定量から急激な結晶化が生じる現象は,溶液中で の均一核生成を連想させるが,今回の試料の合成は, ゾルゲル法のような溶液を介さない反応焼結によるも のであり,一般の凝固理論がどの程度適応できるかは 定かではない.ただSiとLaの自由エネルギーの違い に依存することは推察される.ちなみに,Si:La=1:1 では硝酸ランタンの粉末が十分に溶解できず焼成試料 そのもの作製できなかった.

少量のランタンを入れた場合のみでは、アモルファ ス構造の Si 配置の一部に La が入るのみで非晶質構造 が維持できるものの、La の添加量を大きくしていくと、 一部にクラスターまたは結晶化が進行してシリカのア モルファス構造が維持できなくなることが推察される が、この解明については、もともとの Si の原子半径と La およびゼオライト<sup>6,7)</sup>での Si の置換元素である Al など他の比較元素の原子半径,電子軌道・密度さらには ポテンシャルエネルギーに及ぶ結晶学的、量子化学的 な解析が今後必要となると考えられる.

ただ、マクロな視点でのアモルファスなシリカ内で のランタンによる結晶化に関しては、少量のランタン ではあまり影響を及ぼさないこと、また、このシリカ に添加できるランタンの最大量は La/ La+Si にして 33~50%の範囲であることが判明した.

そして,この実験結果から,現在進行中の CO<sub>2</sub>の吸 着用 La ドープシリカ開発の今後に関しては以下の事 が考察される. まず基本的に,Laドープシリカ材料が CO<sub>2</sub>の吸着能 力を向上させるためには,標的物質を選択的に捉える ために結晶中のイオン等の結合力や触媒機能が効果的 に働く結晶構造と物質の透過性を左右する結晶のサイ ズ(原子間孔径)の検討が必要となる.また,物質を 吸着するためには広い表面積を有する多孔質構造も要 求される.



Fig.4 The schema of Silica crystal structure for CO<sub>2</sub> absorption

現在 Si の一部を Al と置換したゼオライトが吸着物 質として注目されていることからも分かるように, La がドープされることで,シリカ内に CO<sub>2</sub>が吸着されや すい結晶構造を形成されることは可能であるが,まだ La をドープしたシリカの CO<sub>2</sub> 吸着機能に関しての詳 細な結晶構造については不明であり, TEM や XRD で の今後の解析と実際の CO<sub>2</sub>の吸着性能についての評価 が必要である.

もう一つ,もう少しマクロなレベルでの吸着機能と しては微細多孔質構造の形成が要求される.ここで必 要なホールのサイズは非常に小さいので,今回の SEM 画像のレベルでは全く確認できなかった.しかしなが ら,シリカの合成段階で多くの異なる La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の結晶面 が存在することは,その基盤上でのシリカや酸化ラン タンの結晶成長を想定しても微細なポーラス構造を形 成していく上で有利と考えられ,今回の La の量を変 えることで結晶面数が増加したことは,この材料の多 孔質構造の制御方法に大きく寄与するかも知れない.

今後は以上の点に着目しながら、CO<sub>2</sub>吸着用シリカの開発を進めていく予定である.

## 5. 謝辞

本研究は、一般財団法人ファインセラミックスセン ターJFCC との共同研究で行われたものであり、幾原 裕美博士(大同大学客員教授)をはじめ関係スタッフ の方々に感謝致します.

## 参考文献

- 1) 室内環境学概論 室内環境学会 編
- Yumi H. Ikuhara, Tomohiro Saito, Yukichi Sasaki, Seiji Takahashi, and Tsukasa Hirayama. Determination of reversible hydrogen adsorption site in Ni-nanoparticle-dispersed amorphous silica for hydrogen separation at high temperature. J. Mater. Res. Vol.25 2008-2014 (2010)
- Yumi H. Ikuhara,<sup>†</sup> Tomohiro Saito, Seiji Takahashi, Yukichi Sasaki, and Tsukasa Hirayama. Synthesis and Microstructural Analysis of Homogeneously Dispersed Nickel Nanoparticles in Amorphous Silica. J. Am. Ceram. Soc., 95 [2] 524–529 (2012)
- 4)小出剛之,小林正典,川西美里,幾原裕美 金属ドー プシリカ多孔質複合体の合成と構造解析 日本機 械学会年次大会講演論文集 (2014)
- 5) 森本信男 造岩鉱物学「10 シリカ鉱物」 p.191-19 東京大学出版会, (1989)
- 6) ゼオライトの科学と応用: 富永博夫 編, 講談社 サイエンティフィク (1987)
- 7) 中野 岳仁, 荒木 新吾, 加賀山 朋子, 野末 泰夫 ゼオライト結晶のナノ細孔へのアルカリ金属圧入 と電子状態 高圧力の科学と技術 22 p.44-50 (2012)